

【公報種別】特許法第 17 条の 2 の規定による補正の掲載

【部門区分】第 6 部門第 1 区分

【発行日】平成 17 年 12 月 22 日 (2005.12.22)

【公表番号】特表 2004-536291 (P2004-536291A)

【公表日】平成 16 年 12 月 2 日 (2004.12.2)

【年通号数】公開・登録公報 2004-047

【出願番号】特願 2002-583938 (P2002-583938)

【国際特許分類第 7 版】

G 0 1 N 1/18

B 0 1 J 19/00

G 0 1 N 1/10

// C 1 2 M 1/00

C 1 2 N 15/09

C 1 2 Q 1/68

G 0 1 N 1/00

G 0 1 N 37/00

【F I】

G 0 1 N 1/18

B 0 1 J 19/00 3 2 1

G 0 1 N 1/10 H

C 1 2 N 15/00 A

C 1 2 M 1/00 A

C 1 2 Q 1/68 A

G 0 1 N 1/00 1 0 1 L

G 0 1 N 37/00 1 0 1

【手続補正書】

【提出日】平成 17 年 3 月 10 日 (2005.3.10)

【手続補正 1】

【補正対象書類名】特許請求の範囲

【補正対象項目名】全文

【補正方法】変更

【補正の内容】

【特許請求の範囲】

【請求項 1】

1 対の対向主面および中心、第 1 の部分、ならびに第 2 の部分を含む矩形本体と、  
各々が、入力室と、出力室と、前記入力室と前記出力室との間に配置された一次処理室  
とを含む、前記本体の第 1 の部分内に配置された、複数の第 1 の処理アレイと、

各々が、入力室と、出力室と、前記入力室と前記出力室との間に配置された一次処理室  
とを含む、前記本体の第 2 の部分内に配置された、複数の第 2 の処理アレイと、を含むサ  
ンプル処理装置であって、

前記第 1 の部分および前記第 2 の部分が、前記中心の両側に配置され、

前記複数の処理アレイの一次処理室が、前記本体の中心の周りに円弧に配列され、

前記複数の第 2 の処理アレイの一次処理室が、前記本体の中心の周りに円弧に配列され  
ている、サンプル処理装置。

【請求項 2】

前記第 1 の処理アレイおよび前記第 2 の処理アレイの一次処理室によって形成された前  
記円弧が、中心が前記本体の中心に配置された一次処理室円を定める、請求項 1 に記載の  
装置。

**【請求項 3】**

前記複数の第 1 の処理アレイの入力室、および前記複数の第 2 の処理アレイの入力室が、直線格子アレイに配列されている、請求項 1 に記載の装置。

**【請求項 4】**

前記複数の処理アレイの少なくとも 1 つの出力室が直線格子アレイに配列されている、請求項 1 に記載の装置。

**【請求項 5】**

少なくとも 2 つの前記第 1 の処理アレイの入力室が、共通入力室を含む、請求項 1 に記載の装置。

**【請求項 6】**

各々の前記第 1 の処理アレイの前記一次処理室と前記出力室との間に配置された二次処理室と、

各々の前記第 2 の処理アレイの前記一次処理室と前記出力室との間に配置された二次処理室とをさらに含み、

前記第 1 の処理アレイの二次処理室が、前記本体の中心の周りに円弧に配列され、

前記第 2 の処理アレイの二次処理室が、前記本体の中心の周りに円弧に配列されている、請求項 1 に記載の装置。

**【請求項 7】**

サンプル処理装置を使用する方法であって、

サンプル処理装置を提供するステップであって、前記サンプル処理装置が、1 対の対向主面および中心、第 1 の部分、ならびに第 2 の部分を含む矩形本体を含み、前記第 1 の部分および前記第 2 の部分が、前記中心の両側に配置され、前記サンプル処理装置が、前記本体の第 1 の部分内に配置された、複数の第 1 の処理アレイを含み、前記第 1 の処理アレイの各々が、入力室と、出力室と、前記入力室と前記出力室との間に配置された一次処理室とを含み、前記複数の処理アレイの一次処理室が、前記本体の中心の周りに円弧に配列され、前記サンプル処理装置が、前記本体の第 2 の部分内に配置された、複数の第 2 の処理アレイを含み、前記第 2 の処理アレイの各々が、入力室と、出力室と、前記入力室と前記出力室との間に配置された一次処理室とを含み、前記複数の第 2 の処理アレイの一次処理室が、前記本体の中心の周りに円弧に配列されるステップと、

少なくとも一部の前記第 1 および第 2 の処理アレイの入力室内にサンプル材料をロードするステップと、

前記サンプル処理装置を、前記本体の中心を通して延在する回転軸の周りに回転させることによって、前記入力室から、少なくとも一部の前記一次処理室に、前記サンプル材料を搬送するステップであって、前記一次処理室が、前記入力室より前記回転軸から遠くに配置されているステップとを含む、方法。

**【請求項 8】**

前記サンプル処理装置を回転させながら、電磁エネルギーを前記一次処理室内に供給するステップをさらに含む、請求項 7 に記載の方法。